

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016年4月14日(14.04.2016)



(10) 国際公開番号

WO 2016/056352 A1

- (51) 国際特許分類:
C23C 14/34 (2006.01) H01L 45/00 (2006.01)
C04B 35/00 (2006.01) H01L 49/00 (2006.01)
H01L 27/105 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/075952
- (22) 国際出願日: 2015年9月14日(14.09.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2014-205389 2014年10月6日(06.10.2014) JP
- (71) 出願人: J X 金属株式会社(JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008164 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 成田 里安(NARITA Satoyasu); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町臼場187番地4 J X 日鉱日石金属株式会社 磯原工場内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: 小越 勇, 外(OGOSHI Isamu et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門2丁目9番14号 発明会館5階 小越国際特許事務所 Tokyo (JP).

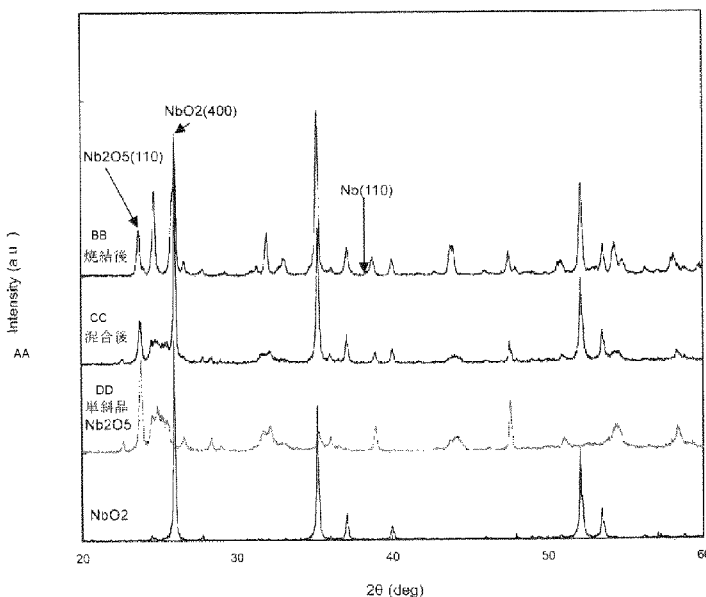
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: NIOBIUM OXIDE SINTERED COMPACT, SPUTTERING TARGET COMPRISING SINTERED COMPACT, AND METHOD FOR MANUFACTURING NIOBIUM OXIDE SINTERED COMPACT

(54) 発明の名称: ニオブ酸化物焼結体及び該焼結体からなるスパッタリングターゲット並びにニオブ酸化物焼結体の製造方法



AA Intensity (a. u.)
BB After sintering
CC After mixing
DD Monoclinic crystal

(57) Abstract: The present invention is a niobium oxide sintered compact characterized by having the composition NbO_x ($2 < x < 2.5$). The present invention provides a niobium oxide sintered compact which can be applied as a sputtering target for forming a high-quality resistance change layer for ReRAM. The present invention particularly addresses the problem of providing a high-density niobium oxide sintered compact suitable for stabilization of sputtering.

(57) 要約: 本発明は、 NbO_x ($2 < x < 2.5$) の組成を有することを特徴とするニオブ酸化物焼結体。ReRAM用の高品質な抵抗変化層を形成するためのスパッタリングターゲットに適用できるニオブ酸化物焼結体を提供するものである。特にスパッタリングの安定化に適した高密度のニオブ酸化物焼結体を提供することを課題とする。

WO 2016/056352 A1